17p-D6-9

アモルファスカーボンの触媒支援熱処理 による SiO₂ 上へのグラフェンの成長 Graphene Growth on SiO₂ by Heat Treatment of Amorphous Carbon with metal catalysts

名大院工, ⁰長谷部 洋平,中原 仁,安坂 幸師,齋藤 弥八

Nagoya Univ. , °Yohei Hasebe, Hitoshi Nakahara, Koji Asaka, and Yahachi Saito

E-mail: hasebe@surf.nuqe.nagoya-u.ac.jp

【はじめに】グラフェンは伝導度や柔軟さなどにおい て優れた特性を有し、デバイス応用が期待される材料 である。本研究では、金属触媒を用いてアモルファス カーボン(a-C)を加熱することで、転写せずにSiO₂上に 直接グラフェンを成長させた。

【実験方法】Fig. 1(a)に示すように、Si 基板上にSiO₂、 a-C および触媒金属層を同一チャンバー内で電子ビー ム蒸着した。触媒金属として鉄(Fe)、ニッケル(Ni)、 銅(Cu)を用いた。この試料を真空加熱することで a-C 層をグラフェン成長させた(Fig. 1(b))。加熱温度は 700℃および 900 ℃で加熱時間は 30 分とした。得られ た試料をラマン分光法、断面透過電子顕微鏡法(TEM)な どによって分析評価した。

【結果】Fig. 2はFe(60 nm)/a-C(10 nm)/SiO₂(30 nm)/Siを900 ℃で加熱した後の断面 TEM 像であり、グラフェンがSiO₂層とFe層の界面に成長していることを示している。Fig. 3はこの試料での加熱前後のラマンスペクトルである。加熱前の試料では1100-1700 cm⁻¹にわたる幅の広いピークが観測され、グラフェン骨格を持たないアモルファス構造であることが分かる。加熱後の試料では明瞭なGおよび2Dピークが見られ、さらにこれらの強度比から多層のグラフェンの存在が示唆される。この結果はFig.2で示した断面 TEM 像の結果とも一致しており、触媒金属を用いて加熱することで、アモルファスカーボンがグラファイト化したものと考えられる。触媒金属としてNiを用いた試料でも同様に明瞭なGおよび2Dピークを持つラマンスペクトル



Fig. 1. (a) SiO_2 , a-C and Fe layers are deposited on a Si by electron-beam deposition. (b) The films are heat treated to graphitize.



Fig. 2. Cross-sectional TEM image of the interface between Fe and SiO_2 layers. Multilayer graphene is indicated by an arrow.



が得られたが欠陥に由来するDピークの強度が大きい。Fig. 3. Raman spectra of carbon films.